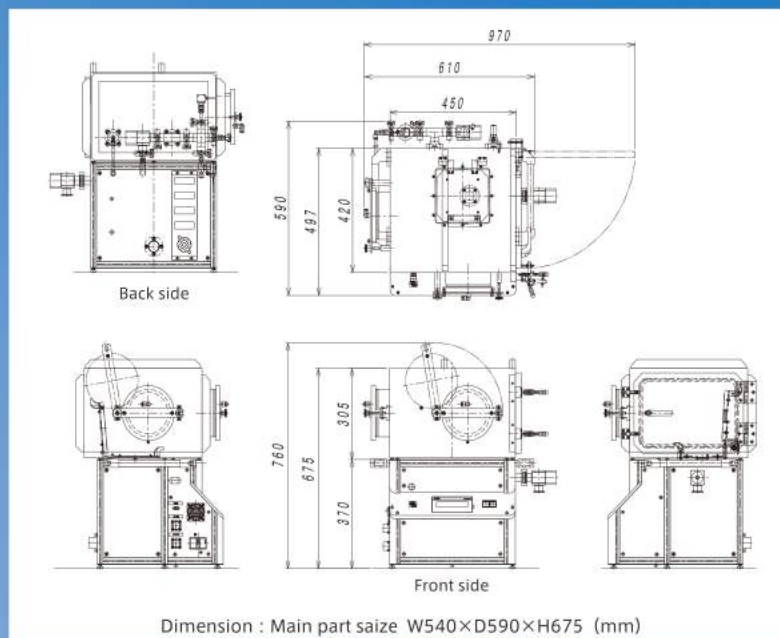
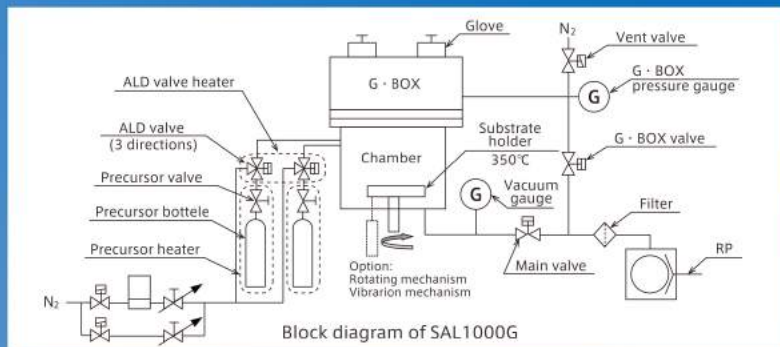


SAL1000 G

ALD原子层沉积系统

Atomic Layer Deposition with Glove Box



株式会社 菅製作所

本社 〒049-0101 北海道北斗市道分3-2-2
 札幌オフィス 〒001-0014 北海道札幌市北区北14条西3-1-20-301
 東京オフィス 〒107-0052 東京都港区赤坂4-13-5-266
 ROMサービス 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-2-6 産広美ビル3F
 静岡オフィス 〒412-0042 静岡県御殿場市萩原761-1-202

全共通 TEL. 050-3734-0730 FAX. 050-3734-0731
 ✉ sales_ml@suga.ne.jp URL : http://www.suga.ne.jp/

凯戈纳斯仪器商贸（上海）有限公司

地址：上海市虹口区四平路775弄1号，天宝华庭1115室
 Tel: 021-58362582

凯戈纳斯仪器商贸（上海）有限公司

ALD 装置

SAL1000G

Atomic Layer Deposition Equipment with Glove Box

SAL1000G是一款包含手套箱小型桌面ALD原子层沉积系统，具有良好的均匀性及优越的阶梯覆盖性能，使用户能够精确控制每个原子层的沉积。通过手套箱，可在惰性气体环境下进行操作，并且可以防止吸入纳米级颗粒。该设备是小型且经济实惠的型号，与主机和控制电源相结合，追求仅在桌面上更容易操作。它能够处理多达4个晶圆的沉积，并对每个部件采取安全措施。

AGUS提供沉积测试服务作为我们支持的一部分，以提高实验准确性。请随时与凯戈纳斯仪器商贸（上海）有限公司联系。

特点：

- 多样性 -

- 真空可移动的手套箱可以处理易氧化的样品。
- 前驱体标配两组阀门和气瓶。
- 可选择将前驱体加热至200摄氏度。
- 可选择基片自动旋转支架。
- 可选择粉体沉积配件。
- 可选择经济实惠的废气处理设备。

- 性能 -

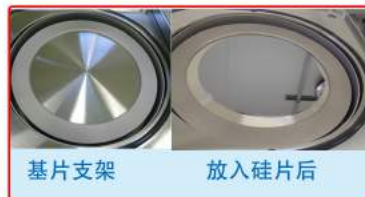
- 保证基片表面上的每个均匀原子层针孔自由层沉积。
- 通过阶梯覆盖沉积在不均匀或3D形状的表面。
- 与CVD和PVD相比，可以获得更好的沉积，特别是对于具有更高纵横比和多孔沉积材料。

- 操作界面友好 -

- 触摸屏使用户可以轻松设置配方或沉积过程，并检查每个驱动系统的运动。
- 可进行自动沉积，并在沉积完成后自动完成N₂排放。
- 手套箱的真空排气和惰性气体的引入也可自动完成。

- 安全性 -

- 这是具有各种互锁功能的高级设备。
- 具有轻柔关闭功能的顶部舱口使用户可以轻松地装载和卸载基片。



性能		
真空度	到达压力	≤5Pa
成膜性能	膜厚分布	≤± 3% (φ 100mm)

设备构成	
设备型号	SAL1000G
成膜方向	下表面
最大基底尺寸	φ 100mm or 4 inch
基底加热器温度	最高 350°C
前驱体数	2
前驱体最高温度	最高 150°C
净化气体	N ₂ (气体控制: 带流量计针型阀)
手套箱	有机玻璃, 真空-氮气吹扫式
真空泵	162L/min 旋片式真空机械泵
重量	本体: 50kg, 手套箱: 35kg, 真空泵: 27kg
可选配置	基片自动旋转支架 粉体沉积配件 废气处理设备 前驱体加热器- 200°C

安装要求		
电源要求	电源	3相、200V ± 10%、15A、50/60Hz
	接地	< 100Ω
	线缆	5m 附赠
N ₂ 吹扫气体	供给压力	0.1 ~ 0.2Mpa
	接口	1/4 Swagelok
压缩空气	供给压力	0.6 ~ 0.8Mpa
	接口	φ 6mm 接口
真空泵排气口	排气口	KF-25 法兰
设备排气口	排气口	φ 38mm x L28 软管适配器
安装尺寸	W1000 x D700 x H900	